

Nova abordagem no posicionamento de implantes em incisivos laterais superiores



Diego Klee¹

Como citar: Klee D, Lima RBB, Ribeiro GU. Nova abordagem no posicionamento de implantes em incisivos laterais superiores. *ImplantNews* 2025 Jul-Ago;10(4):542-3.

1. Professor Titular do departamento de Odontologia – UFSC; Doutor em Odontologia Restauradora na especialidade de Prótese Dentária – Unesp/SJC | ☎ 0000-0002-6927-331X.

Autores convidados



Rodrigo B. Barbosa Lima²

2. Mestre em Implantodontia – São Leopoldo Mandic; doutorando em Odontologia – UFSC.



Gerson Ulema Ribeiro³

3. Professor titular de Ortodontia na UFSC; pós-doutorado em Ortodontia na Baylor College of Dentistry - Dallas - TX - USA; diplomado pelo Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial; diretor científico da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR.

As expectativas dos pacientes em relação ao tratamento com implantes mudaram ao longo dos anos, e a estética desempenha um papel importante na definição de sucesso da reabilitação. Os dentes anteriores superiores são, indiscutivelmente, os mais desafiadores para os implantodontistas.

Implantes e coroas cerâmicas nos incisivos laterais superiores representam um desafio especial, mesmo para profissionais experientes. O posicionamento da crista óssea alveolar (COA) determina a disposição gengival, bem como a manutenção do nível das papilas interdentes. Dentro de padrões de normalidade, a COA acompanha a junção cimento-esmalte (JCE), localizando-se, em média, à 1,5 mm deste marco anatômico.

Nos incisivos laterais superiores, a menor dimensão vestibulolingual no terço cervical faz com que a JCE, na face mesial, seja uma curva mais fechada e coronal (Fig. 1), enquanto a JCE distal dos incisivos centrais apresenta uma curvatura mais aberta, cerca de 1 mm mais achatada que a mesial do lateral (Fig. 2). Assim, a altura da crista óssea, bem como da papila entre incisivos centrais e laterais superiores, com o completo preenchimento da ameia cervical, evitando o espaço negro (black space), depende muito da face mesial (JCE) dos laterais.

A perda deste elemento acarreta sérios prejuízos para a manutenção do pico da papila mesial. O posicionamento tridimensional dos implantes poderá ter papel fundamental no resultado desejado ao substituir a raiz de um incisivo lateral superior perdido.

Combinando nossa experiência clínica e a literatura pertinente, as seguintes alterações no posicionamento de implantes nestes locais podem ser sugeridas: o longo eixo do implante e/ou do pilar protético deve ser direcionado à borda incisal da futura coroa, bem como uma suave distalização do implante no espaço edêntulo, permitindo uma morfologia de coroa restauradora com contorno cervical semelhante ao dente natural e mais espaço para a formação e condicionamento tecidual mesial.



Figura 1: A junção cimento-esmalte da face mesial dos incisivos laterais apresenta uma curva mais fechada, cerca de 1 mm mais coronal que este marco anatômico na face distal dos incisivos centrais.

Figura 2: A junção cimento-esmalte na face distal dos incisivos centrais apresenta uma curvatura mais aberta e achatada.



Figura 3: Paciente com agenesia do incisivo lateral superior esquerdo (22). Após o tratamento ortodôntico finalizado, iniciou-se o planejamento cirúrgico para instalação de implante nesta região.



Figura 4: Cirurgia guiada para instalação do implante osseointegrável na região do dente 22 (Maestro CM AR 3.5/11 mm - Implacil Osstem), com emprego do kit Implaguide (Implacil Osstem).



Figura 5: Vista oclusal: Perceba o posicionamento do implante: o longo eixo direcionado à borda incisal da futura coroa, e uma suave distalização no espaço edêntulo.



Figuras 6 e 7: Vista frontal e oclusal do pilar instalado em boca (Pilar Ideal - Implacil Osstem). A distalização do implante oferece mais espaço para a formação e condicionamento tecidual mesial.



Figura 8: Vista frontal da coroa cimentada em boca, com uma morfologia cervical semelhante ao dente natural e satisfatória formação tecidual mesial.